

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 3 区分
 【発行日】平成 19 年 11 月 15 日 (2007.11.15)

【公表番号】特表 2007-508446 (P2007-508446A)
 【公表日】平成 19 年 4 月 5 日 (2007.4.5)
 【年通号数】公開・登録公報 2007-013
 【出願番号】特願 2006-535547 (P2006-535547)
 【国際特許分類】

C 0 9 K 3/00 (2006.01)

【 F I 】

C 0 9 K 3/00 R

【手続補正書】
 【提出日】平成 19 年 9 月 26 日 (2007.9.26)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

0 . 2 % ~ 0 . 6 % の界面活性剤成分と、

0 . 0 5 % ~ 0 . 5 % の量で存在する、アニオンパーフルオロアルキル含有界面活性剤、アルキルスルホネート、アラルキルスルホネートまたはアルカリールスルホネート、アルキルスルフェート、アラルキルスルフェートまたはアルカリールスルフェート、アルキルホスホネート、アラルキルホスホネートまたはアルカリールホスホネート、アルキルホスフェート、アラルキルホスフェートまたはアルカリールホスフェート、アルキルベタイン、アラルキルベタインまたはアルカリールベタイン、アラルキルホスホネートスルテインまたはアルカリールホスホネートスルテインならびに脂肪イミダゾリンおよびそれらの誘導体からなる群から選択される 1 種以上の化合物を含有する安定剤成分と、

溶媒と

を含む界面活性剤組成物で被覆された親水性表面であって、

基材上で乾燥させ基材上に被覆された時に溶媒を含有しない前記界面活性剤組成物が 0 . 2 : 1 ~ 1 2 : 1 w t / w t の比で前記界面活性剤および前記安定剤を含み、「広がり滴試験」によって示された前記親水性の特性が、23 および相対湿度 50 % で 3 週間エージング後に元の広がり滴直径の少なくとも 85 % を保持することを特徴とする親水性表面。

【請求項 2】

0 . 2 : 1 ~ 1 2 : 1 w t / w t の比で界面活性剤成分および安定剤成分を含む無孔質基材上に被着させた被膜であって、広がり滴直径によって示された親水性の特性が、23 および相対湿度 50 % で 3 週間エージング後に元の滴直径の少なくとも 85 % を保持し、かつ前記安定剤成分が、アニオンパーフルオロアルキル含有界面活性剤、アルキルスルホネート、アラルキルスルホネートまたはアルカリールスルホネート、アルキルスルフェート、アラルキルスルフェートまたはアルカリールスルフェート、アルキルホスホネート、アラルキルホスホネートまたはアルカリールホスホネート、アルキルホスフェート、アラルキルホスフェートまたはアルカリールホスフェート、アルキルベタイン、アラルキルベタインまたはアルカリールベタイン、アラルキルホスホネートスルテインまたはアルカリールホスホネートスルテインならびに脂肪イミダゾリンおよびそれらの誘導体からなる群から選択される 1 種以上の化合物を含有することを特徴とする被膜。

【請求項 3】

基材と、

無溶媒基準で 2.5 ~ 9.5 重量 % の界面活性剤成分および無溶媒基準で 5 ~ 7.5 重量 % の安定剤成分を含む被膜とを含み、

前記被膜の接触角が 2.5 で 1.3 週間にわたるエージング後に 2.5 度を超えないことを特徴とする、体液にさらされるマイクロ流体装置。

【請求項 4】

請求項 1 に記載の界面活性剤組成物を基材に被着させる工程と、

前記界面活性剤組成物を基材上で乾燥させる工程とを含む基材上で親水性表面を形成する方法であって、

基材上で乾燥させ基材上に被覆された時に溶媒を含有しない前記界面活性剤組成物が 0.2 : 1 ~ 1.2 : 1 wt / wt の比で前記界面活性剤および前記安定剤を含み、「広がり滴試験」によって示された前記親水性の特性が、2.3 および相対湿度 50 % で 3 週間エージング後に元の広がり滴直径の少なくとも 85 % を保持することを特徴とする親水性表面を形成する方法。